

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2004年7月15日 (15.07.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/058450 A1

- (51) 国際特許分類⁷: **B24B 37/00**, G11B 5/73, 5/84
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2003/016671
- (22) 国際出願日: 2003年12月25日 (25.12.2003)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2002-378735
2002年12月26日 (26.12.2002) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日本板硝子株式会社 (NIPPON SHEET GLASS COMPANY, LIMITED) [JP/JP]; 〒541-8559 大阪府 大阪市 中央区北浜四丁目7番28号 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 堀坂 環樹 (HORISAKA, Tamaki) [JP/JP]; 〒541-8559 大阪府 大阪市 中央区北浜四丁目7番28号 日本板硝子株式会

社 内 Osaka (JP). 鈴木 弘一 (SUZUKI, Koichi) [JP/JP]; 〒541-8559 大阪府 大阪市 中央区北浜四丁目7番28号 日本板硝子株式会社 内 Osaka (JP). 南 明秀 (MINAMI, Akihide) [JP/JP]; 〒541-8559 大阪府 大阪市 中央区北浜四丁目7番28号 日本板硝子株式会社 内 Osaka (JP).

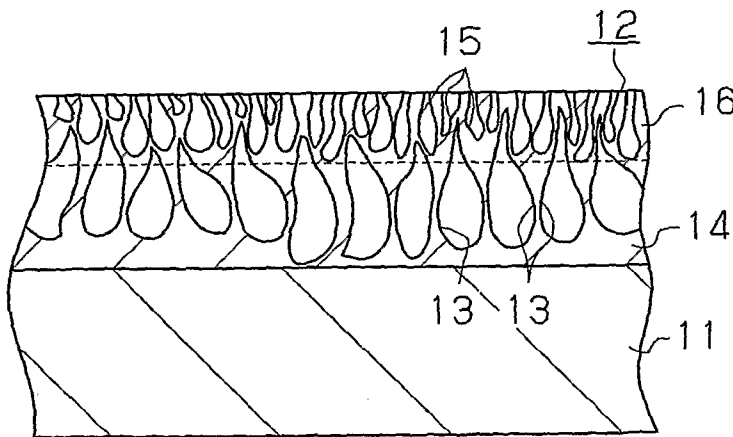
- (74) 代理人: 恩田 博宣 (ONDA, Hironori); 〒500-8731 岐阜県 岐阜市 大宮町2丁目12番地の1 Gifu (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

[続葉有]

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING GLASS SUBSTRATE FOR INFORMATION RECORDING MEDIUM, POLISHING APPARATUS AND GLASS SUBSTRATE FOR INFORMATION RECORDING MEDIUM

(54) 発明の名称: 情報記録媒体用ガラス基板の製造方法及び情報記録媒体用ガラス基板



(57) Abstract: A glass substrate for information recording mediums is produced by polishing the surface of a rough glass plate. The polishing of the rough glass plate has two steps, namely a primary polishing step for lapping the surface of the rough glass plate flat and a secondary polishing step for finely polishing the lapped surface of the rough glass plate to make it flatter. The secondary polishing step has two stages in which a polishing pad composed of a foam is used, namely a first polishing stage wherein an abrasive containing abrasive grains of a cerium oxide is used and a second polishing stage wherein an abrasive containing abrasive grains of a silicon oxide is used. Between the first and second polishing stages, rinsing is conducted to wash the rough glass plate after

the first polishing with use of a cleaning liquid, so that the abrasive grains used in the first polishing stage and remaining in the polishing pad are rinsed away.

(57) 要約: 情報記録媒体用ガラス基板は、ガラス素板の表面を研磨することによって製造される。ガラス素板の研磨は、ガラス素板の表面を平滑に粗研磨するための1次研磨処理を施す工程と、粗研磨されたガラス素板の表面をさらに平滑に精密研磨するための2次研磨処理を施す工程との2工程に分けて行われる。2次研磨処理では、発泡体よりなる研磨パッドが使用され、酸化セリウムの砥粒を含む研磨剤を用いる前研磨と、酸化ケイ素の砥粒を含む研磨剤を用いる後研磨とが2段階に分けて行われる。前研磨及び後研磨の間で、洗浄液を用いて前研磨の後のガラス素板を濯ぐためのリンス処理が施され、前研磨の際に研磨パッド内に留まっていた砥粒がリンス処理の際に洗い流される。

WO 2004/058450 A1



FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK,
TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,
GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

— 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受領の際には再公開される。

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。